

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第3区分

【発行日】平成17年9月22日(2005.9.22)

【公開番号】特開2003-147337(P2003-147337A)

【公開日】平成15年5月21日(2003.5.21)

【出願番号】特願2002-132738(P2002-132738)

【国際特許分類第7版】

C 0 9 K 3/14

B 2 4 B 37/00

B 2 4 B 57/02

G 1 1 B 5/73

G 1 1 B 5/84

H 0 1 L 21/304

【F I】

C 0 9 K 3/14 5 5 0 D

C 0 9 K 3/14 5 5 0 Z

B 2 4 B 37/00 H

B 2 4 B 57/02

G 1 1 B 5/73

G 1 1 B 5/84 A

H 0 1 L 21/304 6 2 2 D

【手続補正書】

【提出日】平成17年4月11日(2005.4.11)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

水性媒体に砥粒、リンを含む無機酸またはその塩及び他の無機酸またはその塩、酸化剤を配合したことを特徴とする研磨用組成物。

【請求項2】

砥粒が、アルミナ、チタニア、シリカ、ジルコニアからなる群より選ばれた少なくとも1種である請求項1に記載の研磨用組成物。

【請求項3】

砥粒の平均粒子径が、0.001~0.5μmである請求項1または2に記載の研磨用組成物。

【請求項4】

砥粒が、コロイド粒子である請求項1乃至3のいずれか1項に記載の研磨用組成物。

【請求項5】

リンを含む無機酸が、リン酸またはホスホン酸である請求項1乃至4のいずれか1項に記載の研磨用組成物。

【請求項6】

他の無機酸が、硝酸、硫酸、アミド硫酸、ホウ酸からなる群より選ばれた少なくとも1種である請求項1乃至5のいずれか1項に記載の研磨用組成物。

【請求項7】

酸化剤が、過酸化物、過ホウ酸塩、過硫酸塩、硝酸塩から選ばれた少なくとも1種であ

る請求項 1 乃至 6 のいずれか 1 項に記載の研磨用組成物。

【請求項 8】

過酸化物が、過酸化水素である請求項 7 に記載の研磨用組成物。

【請求項 9】

過ホウ酸塩が、過ホウ酸ソーダである請求項 7 に記載の研磨用組成物。

【請求項 10】

pH が 1 ~ 5 である請求項 1 乃至 9 のいずれか 1 項に記載の研磨用組成物。

【請求項 11】

砥粒の含有量が 3 ~ 30 質量 % の範囲内であり、無機酸又はその塩の含有量が 0 . 1 ~ 8 質量 % の範囲内であり、酸化剤の含有量が 0 . 2 ~ 5 質量 % の範囲内であることを特徴とする請求項 1 乃至 10 のいずれか 1 項に記載の研磨用組成物。

【請求項 12】

研磨用組成物が、磁気ディスク基板研磨用組成物である請求項 1 乃至 11 のいずれか 1 項に記載の研磨用組成物。

【請求項 13】

請求項 12 の研磨用組成物で研磨された磁気ディスク基板。

【請求項 14】

請求項 12 に記載の研磨用組成物を用いる磁気ディスク基板の研磨方法。